



专注于芯
功成于艺

产品销售手册

提供一站式半导体微纳工艺加工
和生产解决方案



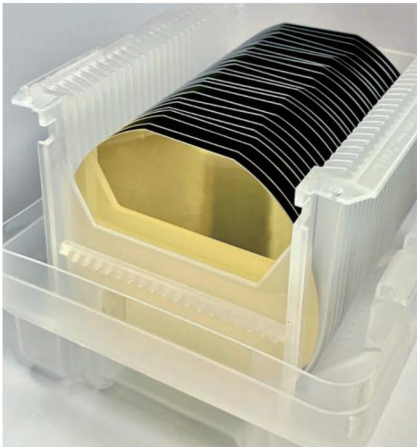
联系电话:155-3970-1757
网址:weinamems@163.com
地址:长沙高新开发区麓西大道1698号
麓谷科技创新创业园B2栋

长沙兰芯半导体有限公司

Changsha lanxin semiconductor co., ltd

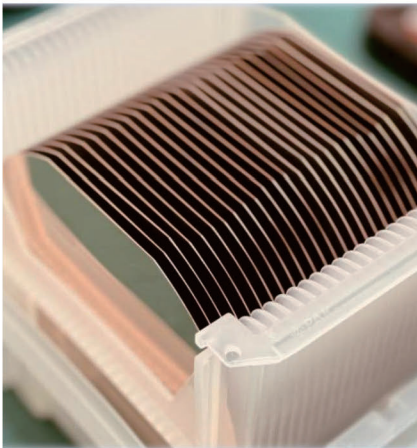
公司目前经营的产品有镀膜硅片、单晶硅片、光刻掩模板、特殊衬底、光刻胶、高纯度试剂、超净耗材等，货源优质，响应速度快，国内外货源充实。公司提供各类微纳加工服务，为各大科研院所提供多种单项加工或综合类器件开发服务。公司与国内多家研究单位和公司机构有长期的委托加工合作关系，设备齐全，服务及时，适合各类加工需求。公司拥有一支高素质的服务队伍，致力于帮助广大科研和科技创新工作者实现梦想。

公司已与国内众多知名科研单位进行了广泛的业务合作，高质量的产品与服务为我们赢得了良好的信誉，期待更多的用户能够和我们建立更长久的合作关系。



单面/双面镀金硅片

- ▶ 膜层参数: Cr30nm/Au100nm (可定制)
- ▶ 衬底类型: 硅片/玻璃片/石英片/蓝宝石片
- ▶ 衬底规格: 2/4/6/8/12 寸 (尺寸规格厚度可定制)
- ▶ 膜层粗糙度: $Ra \leq 1nm$
- ▶ 膜层纯度: $\geq 99.999\%$
- ▶ 镀膜工艺: 电子束蒸发/磁控溅射



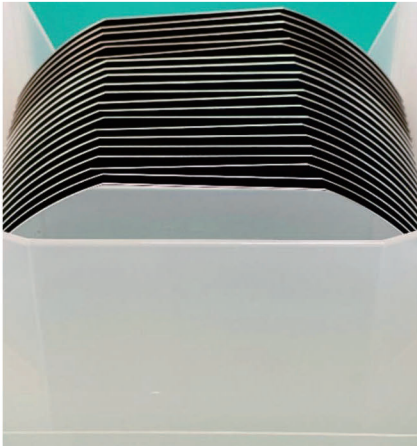
单面/双面镀铜硅片

- ▶ 膜层参数: Ti30nm/Cu500nm (可定制)
- ▶ 衬底类型: 硅片/玻璃片/石英片/蓝宝石片
- ▶ 衬底规格: 2/4/6/8/12 寸 (尺寸规格厚度可定制)
- ▶ 膜层粗糙度: $Ra \leq 1nm$
- ▶ 膜层纯度: $\geq 99.999\%$
- ▶ 镀膜工艺: 电子束蒸发/磁控溅射



单面/双面镀铝硅片

- ▶ 膜层参数: Ti30nm/Al 100nm; Al 100nm (可定制)
- ▶ 衬底类型: 硅片/玻璃片/石英片/蓝宝石片
- ▶ 衬底厚度: 2/4/6/8/12 寸 (尺寸规格厚度可定制)
- ▶ 膜层粗糙度: $Ra \leq 1nm$
- ▶ 膜层纯度: $\geq 99.999\%$
- ▶ 镀膜工艺: 电子束蒸发/磁控溅射



单面/双面镀铂硅片

- 膜层参数: Ti30nm/Pt100nm (可定制)
- 衬底类型: 硅片/玻璃片/石英片/蓝宝石片
- 衬底规格: 2/4/6/8/12 寸 (尺寸规格厚度可定制)
- 膜层粗糙度: Ra≤1nm
- 膜层纯度: ≥99.999%
- 镀膜工艺: 电子束蒸发/磁控溅射



单面/双面镀银硅片

- 膜层参数: Ti30nm/Ag500nm (可定制)
- 衬底类型: 硅片/玻璃片/石英片/蓝宝石片
- 衬底规格: 2/4/6/8/12 寸 (尺寸规格厚度可定制)
- 膜层粗糙度: Ra≤1nm
- 膜层纯度: ≥99.999%
- 镀膜工艺: 电子束蒸发/磁控溅射



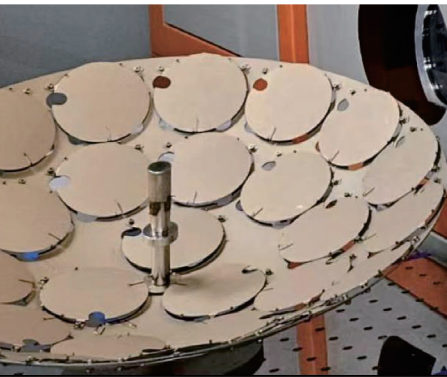
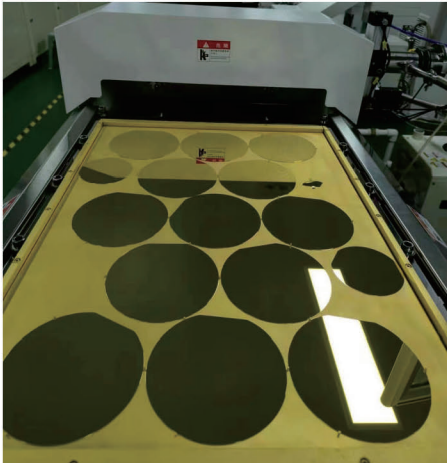
单面/双面镀 Ni 硅片

- 膜层参数: Ti30nm/Al 100nm;Al 100nm (可定制)
- 衬底类型: 硅片/玻璃片/石英片/蓝宝石片
- 衬底厚度: 2/4/6/8/12 寸 (尺寸规格厚度可定制)
- 膜层粗糙度: Ra≤1nm
- 膜层纯度: ≥99.999%
- 镀膜工艺: 电子束蒸发/磁控溅射

镀膜材料及支持的设备

膜层类别	名称	镀膜方式			备注
		电子束蒸发	磁控溅射	热阻蒸发	
金属	Au	√	√	√	
	Ag	√	√	√	
	Al	√	√	×	
	Cr	√	√	×	
	Cu	√	√	√	
	Ti	×	√	×	
	Ni	×	√	×	
	W	×	√	×	
	Pt	√	√	×	
	Sn	×	√	×	
	Mo	×	√	×	
	Zr	×	√	×	
	In	×	√	√	
非金属	C	×	√	×	
合金	AlTi	×	√	×	
	NiCr	×	√	×	97: 3
	NiSi	×	√	×	90: 10
	NiCu	×	√	×	55: 45
	SiAl	×	√	×	
	AlMgSi	×	√	×	
	TiW	×	√	×	
	TiOx	×	√	×	
	Y ₂ O ₃	×	√	×	
	AuSn	×	√	×	
	AgSn	×	√	×	
	MoS ₂	×	√	×	
	WC	×	√	×	
陶瓷	AZO	×	√	×	
	TiN	√	√	×	
	Zns	×	√	×	
	NTO	×	√	×	
	MoO	×	√	×	
	SiO2	×	√	×	
	Al2O3	×	√	×	
	Nb2O5	×	√	×	
	Nb2O5Cr	×	√	×	
	Nb2O5Al	×	√	×	
	ATO	×	√	×	

本司有各类电子束真空镀膜，磁控溅射台，连续镀等各类真空镀膜设备，支持 12英寸及以上非标衬底。



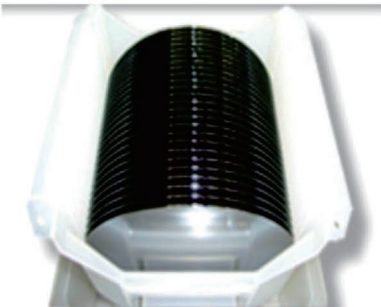
CZ、MCZ硅片（国产/进口）

- ▶ 掺杂类型：N，P ▶ 晶向：<100>，<110>，<111> ▶ 直径：2~12英寸
- ▶ 电阻率：常用各种范围均提供，0.001~10k欧姆.厘米
- ▶ TTV、平整度、弯曲度、翘曲度、直径公差、厚度公差、晶向偏离度等参数严格按照Semi标准执行，如有特殊要求，请来电咨询。
- ▶ 本产品规格质量严格按照semi标准执行，均为世界知名硅片生产大厂提供，semi标准硅片盒（25片）真空密封包装。



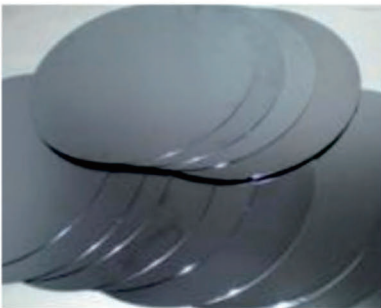
测试片

- ▶ 直径：2~12英寸
- ▶ 测试片是半导体产业中进行设备性能测试、工艺测试所使用的实验片，用来考察各个设备和各段工艺的状态和稳定性。该类片可作为陪片使用，或者作为对电学性能没有要求的正片使用，比如某些MEMS领域或某些材料、物理领域。



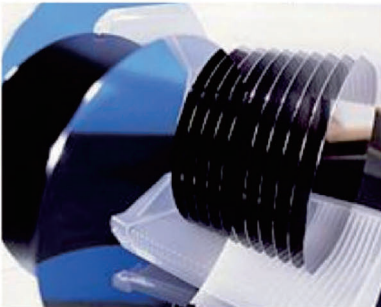
Dummy 片

- ▶ 直径：2~12英寸
- ▶ 只能做有限的工艺测试。一般作为自动化机器传输测试使用；以及对衬底属性和电学性能没有要求的工艺中使用。比如镀膜测试实验



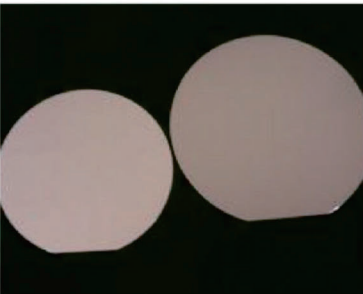
FZ硅片(进口)

- ▶ 掺杂类型：N，P
- ▶ 直径2~8英寸
- ▶ 阻值：几十Ωcm-20kΩcm及以上
- ▶ Fz硅片是指通过区熔法制作的硅片，将硅棒从籽晶一端区域熔化，将熔化区逐渐移动至硅棒另一端，利用杂质的分凝原理和蒸发特性，可以对硅棒进行提纯，并得到很均匀的杂质分布，这种技术通常用于制造高纯度的本征硅片。



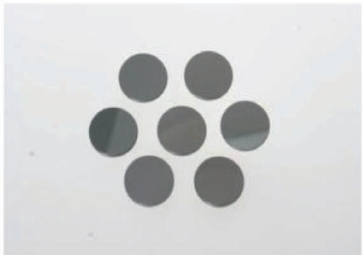
氧化硅片（国产/进口）

- ▶ 直径 1~12英寸
- ▶ 氧化层厚度：100Å~20um
- ▶ 氧化硅片是指在硅片表面存在一层氧化层，氧化层的厚度根据用户需求而定。一般都有库存。
- ▶ 根据产品工艺要求可提供干湿干氧和纯干氧不同工艺氧化片。



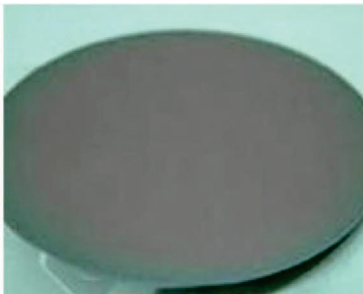
锗片

- ▶ 直径2~8英寸
- ▶ 主要应用与红外窗口和半导体器件的制造。



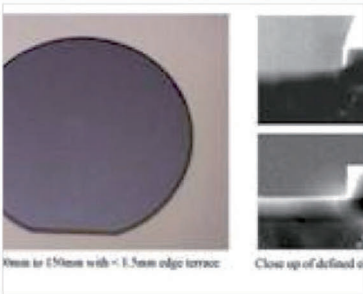
外延片

- ▶ 直径 2~8英寸
- ▶ 在单晶衬底上生长一层同质或异质的薄膜层。
- ▶ 外延生长的新单晶层可在导电类型、电阻率等方面与衬底不同，还可以生长不同厚度和不同要求的多层单晶。
- ▶ 该类硅片需要用户提供详细指标进行定制



SOI硅片

- ▶ 直径4~8英寸
- ▶ 可提供Bonding工艺SOI和Smart cut工艺SOI
- ▶ 器件层厚度最薄可到150nm，埋氧层厚度可到最薄1um
- ▶ 可根据用户所需器件层、埋氧层、体硅各层材料的参数定制，以及多层SOI的定制



其他特殊硅片及耗材

- ▶ 超厚硅片
- ▶ 超薄片，厚度可到10um
- ▶ 金属化硅片（镀金，镀铝，镀铜等等）
- ▶ 超平硅片
- ▶ 特殊晶向硅片
- ▶ 穿孔硅片
- ▶ 绒化硅片
- ▶ 晶棒（国产/进口）
- ▶ 金属靶材，金属颗粒，金属片，纳米颗粒，键合金属丝



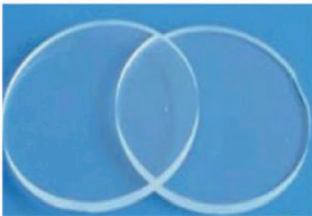
砷化镓片

- ▶ 直径2~6英寸
- ▶ 晶向：<100>
- ▶ 砷化镓片广泛用来制作集成电路衬底、红外探测器、γ光子探测器等。
- ▶ 可提供各类三五族衬底，InP, InAs, GaN, GaSb 等



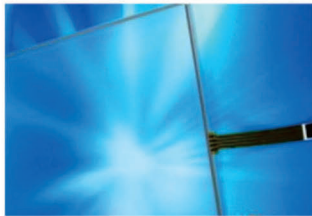
BF33玻璃片

- ▶ 直径2~6英寸
- ▶ 表面光洁度：<0.5nm(两面光学研磨)
- ▶ 包装：真空包装盒包装，25片/盒
- ▶ 可提供各类不同牌号的玻璃片



ITO玻璃片

- ▶ 100*100mm方形
- ▶ 厚度：1.1mm，2.0mm
- ▶ 是在钠钙基或硅硼基片玻璃的基础上，利用溅射、蒸发等多种方法镀上一层氧化铟锡（俗称ITO）膜加工制作成的。



石英片

- ▶ 分为熔融石英（Fused silica）和单晶石英（Quartz Crystal）
- ▶ 直径2~6英寸
- ▶ 其二氧化硅含量可达99.99%以上，可见光透过率85%以上。
- ▶ 熔融石英片根据光学性能分为：远紫外光学石英玻璃 JGS1、紫外光学石英玻璃 JGS2、红外光学石英玻璃 JGS3。具体要求，请来电咨询。



AlN陶瓷片

- ▶ 直径2~6英寸
- ▶ 作为高导热衬底，主要应用在大功率器件
- ▶ 可提供AL2O3氧化铝陶瓷片



蓝宝石片

- ▶ 直径2~4英寸
- ▶ 蓝宝石衬底是适用于LED产业的特种衬底。
- ▶ 如用户需要使用该衬底进行PSS制造，请预先定义衬底表面质量。



其他特殊衬底

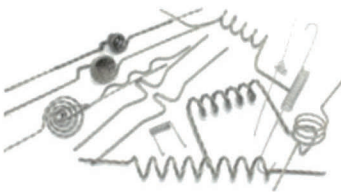
- ▶ SOS ▶ GOI
- ▶ 云母片，氟化钡，氟化钙，铌酸锂等

高品质丝片耗材

金属型材 丝棒杆 箔片板
衬底基片 蒸发舟篮，各种坩埚



石墨坩埚



钨丝篮



钼坩埚



钨 蒸发舟

AS ONE
亚速旺(上海)商贸有限公司

国内代理经销商

网站登载商品数量超过50,000种



半导体溅射靶材


4-12寸芯片制造专用靶材
专业设备，特种加工



应用领域	靶材材料	纯度(%)	主要用途
晶圆制造	铝以及铝合金靶材	4N-5N5	铝互联 铜互联 硅化物接触 金属栅
	铜靶及铜合金靶材	4N-6N	
	钛靶 钨靶 钨钛靶	4N-5N	
	钼靶 钴靶	3N5-4N	
先进封装	金靶 银靶 铂靶	4N-5N	凸点下金属层 重布线层 硅通孔
	铝靶 铜靶	5N-6N	
	镍靶 镍钼靶 镍铂靶	3N5-4N5	
	钛靶 钨钛靶	4N-5N	

蒸发电极材料

金银铂钯，钛镍铝铜
高纯度电子束蒸发材料



合金类别	合金名称	化学式	纯度	供货状态
特种熔炼	镍铬合金	Ni-Cr	3N5	靶材 颗粒
	镍铁合金	Ni-Fe	3N	靶材 颗粒
	镍钒合金	Ni-V	3N	靶材 颗粒
	镍铂合金	Ni-Pt	4N	靶材
	钛铝合金	Ti-Al	3N	靶材
	钛镍合金	Ti-Ni	3N	靶材
	金锗合金	Au-Ge	4N	靶材 颗粒
	金锗镍合金	Au-Ge-Ni	4N	靶材 颗粒
	金锡合金	Au-Sn	4N	靶材 颗粒
粉末冶金	金银合金	Au-Ag	4N	靶材 颗粒
	钛铝合金	Ti-Al	3N	靶材
	铬铝合金	Cr-Al	3N	靶材
	硅铝合金	Si-Al	3N	靶材
	钨钛合金	W-Ti	4N	靶材 颗粒
	钼铌合金	Mo-Nb	3N5	靶材
	铱锰合金	Ir-Mn	3N	靶材
	铂锰合金	Pt-Mn	3N	靶材
	钴铁硼合金	Co-Fe-B	3N	靶材
	铜铟镓硒	CIGS	4N	靶材

特种合金材料

熔炼颗粒块材 粉末冶金粉体
中间合金定制



材料	分子式	纯度	规格
金	Au	4N,5N	φ3x3mm,φ6x6mm
金/锗	Au/Ge	4N	φ4x3mm
金/锗/镍	Au/Ge/Ni	4N	φ4x3mm
金/锡	Au/Sn	4N	φ4x3mm
金/银	Au/Ag	4N	φ3x3mm
银	Ag	4N	φ2x5mm,φ6x6mm
铂	Pt	4N	φ2x5mm
钯	Pd	4N	φ2x5mm
钛	Ti	4N5	φ3x3mm,φ6x6mm
镍	Ni	4N5	φ3x3mm,φ6x6mm
铜	Cu	5N,6N	φ3x3mm,φ6x6mm
铝	Al	5N,5N5	φ3x3mm,φ6x6mm
钒	V	3N5,4N	φ6x6mm
铬	Cr	4N	3-5mm

光学镀膜材料

高纯度金属镀膜材料
化合物镀膜材料

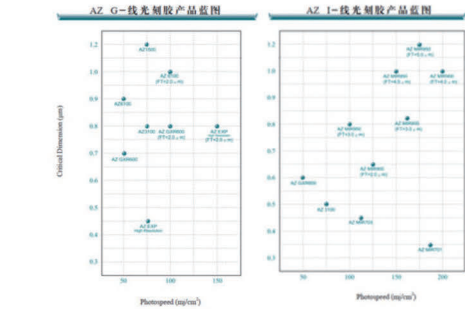
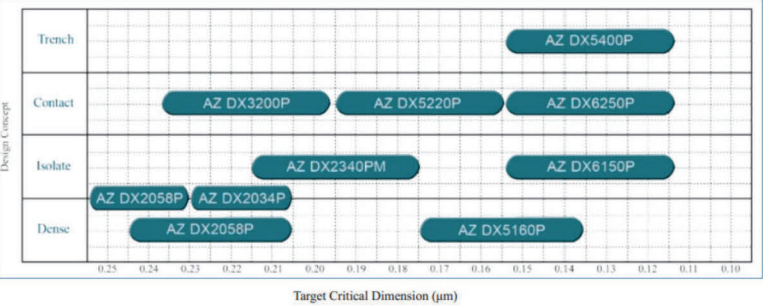


分类	产品名称	常规尺寸	主要用途
单质 镀膜材料	铝 (Al)	φ3*3mm	金属反射膜
	铬 (Cr)	1-10mm	功能膜，金属反射膜
	金 (Au)	φ3*3mm	金属反射膜,装饰膜
	银 (Ag)	φ2*5mm	金属反射膜
	硅 (Si)	1-10mm	减反射膜，热反射膜， 二向滤光片，偏光片
	锗 (Ge)	1-10mm	减反射膜，热反射膜， 二向色滤光片，激光镀膜
化合物 镀膜材料	氧化铝 (Al2O3)	1-3mm	增透膜，多层膜，干涉膜
	氧化铈 (CeO2)	1-3mm	增透膜
	二氧化铪 (HfO2)	1-3mm 压片	复合膜
	氧化铟锡 (ITO)	1-5mm 压片	导电膜
	氧化镁 (MgO)	1-3mm	激光镀膜，粘接促进材料
	五氧化二钽 (Nb2O5)	1-3mm	滤光器；高反膜
	一氧化硅 (SiO)	1-3mm 压片	冷光膜；保护膜；装饰膜
	二氧化硅 (SiO2)	1-3mm 2*2mm	冷光膜；滤光器；绝缘膜
	二氧化钛 (TiO2)	1-3mm 压片	增透膜,滤光片,分光器
	五氧化三钛 (Ti3O5)	1-3mm 压片	分光镜；冷光膜； 滤光器；高反膜
	五氧化二钽 (Ta2O5)	1-3mm 压片	滤光器；高反膜；绝缘膜
	氧化钇 (Y2O3)	1-3mm 压片	复合膜
	氧化锌 (ZnO)	1-3mm	复合膜
	氧化锆 (ZrO2)	1-3mm 压片	复合膜；增透膜；纳米硬化
	氟化铝 (AlF3)	1-3mm	增透膜
	氟化锆 (MgF2)	1-3mm	增透膜,多层膜, 滤光片，分光膜
	氟化钙 (CaF2)	1-3mm	增透膜，偏光镜
	氟化镱 (YbF3)	1-3mm	增透膜，热反射膜/介质膜， 偏光镜，分束镜，激光镀膜
	氟化钇 (YF3)	1-3mm	增透膜，偏光镜，分束镜， 激光镀膜
	硫化锌 (ZnS)	1-10mm	冷光膜；滤光器 高反膜；红外膜
	硒化锌 (ZnSe)	1-10mm	红外膜

AZ系列产品

G线/I线/G线I线通用光刻胶系列		
AZ 1500系列	高感光度标准G线正型光刻胶	High Sensitivity Standard g-line Positive-tone Photoresist
AZ 6100系列	高感光度高耐热性G线正型光刻胶	High Sensitivity & High Heat Stability g-line Positive-tone Photoresist
AZ 3100系列	高感光度高附着性G线I线通用正型光刻胶	High Sensitivity & High Adhesion g/i Cross-over Positive-tone Photoresist
AZ GXR600系列	高感光度高附着性G线I线通用正型光刻胶	High Sensitivity & High Adhesion g/i Cross-over Positive-tone Photoresist
AZ 5200E系列	应用于统一-off工艺图形反转正/负可转换线光刻胶	Image Reversal Pattern Posi/Nega Convertible Photoresist
AZ MIR700系列	高感光度中解像度I线正型光刻胶	Medium-High Resolution i-line Positive-tone Photoresist
AZ MIR900系列	厚膜高感光度高解像度I线正型光刻胶	Thick-film High Resolution i-line Positive-tone Photoresist for High-dose Implantation Process
DUV光刻胶系列		
AZ DX3200P系列	应用于通孔图形的KrF正型光刻胶	KrF Excimer Laser Positive-tone Photoresist for Contact Hole
AZ DX5200P系列	应用于沟槽及通孔图形的超高分辨率KrF正型光刻胶	KrF Excimer Laser Positive-tone Photoresist for Contance Hole and Trench
厚膜光刻胶系列		
AZ P4000系列	超厚膜高感光度标准G线正型光刻胶	Ultra Thick Film High Sensitivity g-line Standard Positive-tone Photoresist
AZ 10XT系列	应用于电镀工艺的超厚膜，高分辨率I线正型光刻胶	Ultra Thick Film High Resolution i-line Standard Positive-tone Photoresist for Plating Process
AZ PLP系列	应用于高精度电镀工艺的超厚膜正型光刻胶	Ultra Thick Film Positive-tone Photoresist for Fine-Pitch Plating Process
防反射涂层/RELACS系列		
AZ AQUATAR系列	应用于超高分辨率图形加工的顶部防反射涂层	Top Anti Reflective Coating for Ultra High Resolution Patterning
AQUATAR-III系列	Non PFOS和Non PFOA的顶部防反射涂层	Non PFOS and Non PFOA type Top Anti Reflective Coating Materials
AZ BARC材料	应用于超高分辨率图形加工的底部防反射涂层	Bottom Anti Reflective Coating for Ultra High Resolution Patterning
AZ Relacs涂布材料	应用于超高分辨率图形加工的光刻胶收缩材料	Resist Shrinking Material for Ultra High Resolution Patterning
特殊用途光刻胶系列		
AZ 8100系列	应用于TAB制造和柔性衬底工艺的正型光刻胶	Positive-tone Photoresist for TAB manufacturing and Process on Flexible Substrate
AZ P1350系列	应用于光罩制造及光罩原盘制造的旋涂正型光刻胶	Positive-tone Photoresist for Photo-mask & Stumper of Photo-media by Spin Coating
液晶显示器/平板显示器用光刻胶系列		
AZ TFP300系列	应用于液晶面板制造的旋涂正型I线光刻胶	Spin Coating Positive-tone Photoresist for Flat Panel Display
AZ TFP600系列	应用于液晶面板制造的超高分感光度，旋涂正型光刻胶	Ultra High Sensitivity Spin Coating Positive-tone Photoresist for Flat Panel Display
AZ SFP系列	应用于第五代液晶面板制造的旋涂正型光刻胶	Spin Coat Positive-tone Photoresist for 5th Generation Flat Panel Displays
AZ SR系列	应用于第五代以上液晶面板制造的Spin-less涂布正型光刻胶	Spin-less Coat Positive-tone Photoresist for over 5th Generation Flat Panel Displays
AZ RFP系列	应用于液晶面板制造的辊涂正型光刻胶	Roll Coat Positive-tone Photoresist For Flat Panel Display
AZ CTP系列	应用于有机电致发光显示器阴极隔离的负型光刻胶	Negative-tone Resist for Cathode Separator on Organic EL Display
辅助化学品系列		
显影液及其他相关化学品		Developers, and other ancillary chemicals
剥离液		Removers for Positive-Tone Photoresist and side-wall polymer

AZ DUV 光刻胶产品蓝图



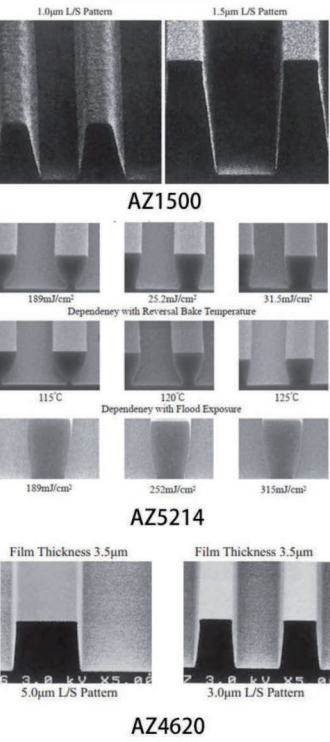
- 1) 正型光刻胶剥离液(胺型)
- AZ Remover 100**
- AZ Remover 200**
- * 含有水溶性有机溶剂，针对正型光刻胶优化的剥离液。可以使用原液或者按照1:1纯水稀释，但是如果对于会腐蚀的衬底，只能使用原液
 - * 对于后烘之后或者离子注入工艺中，推荐使用AZ Remover 200,高温剥离

显影液

- 1) 高纯度有机碱性MIF显影液
- AZ 300MIF显影液**
- 无表面活性剂的标准显影液(TMAH2.38%)
 - 适用于各种显影工艺如Puddle, Dip等
 - 无表面活性剂使Spray显影成为可能
- AZ 600MIF显影液**
- 含表面活性剂的标准显影液(TMAH2.38%)
 - 有效去除显影后及高对比度微细图形加工后的微小残留
- 2) 无机碱性水性显影液
- AZ显影液**
- 通用正型光刻胶显影液
 - 由于含有金属离子，它不是为半导体工业而优化。
- AZ 400K显影液**
- 用于厚膜正型光刻胶的专用显影液
 - 有效防止光刻胶表面的显影损失现象
- AZ 303N显影液**
- AZ PLP系列光刻胶和AZ 8100系列光刻胶的专用显影液

剥离液

- 2) 正型光刻胶剥离液(溶剂型)
- AZ Remover 700**
- * 针对会腐蚀的衬底优化的剥离液
 - * 可以在常温下使用，以减少高温挥发损失
- AZ 400T Stripper**(也可用于干膜和负胶)
- * 可去除plasma蚀刻后的有机残留
 - * 减少金属离子污染
 - * 去胶效率高——>2000 wafers/gallon
 - * 对铝铜衬底不会腐蚀



FUTURREX系列产品

负阻 - 剥离应用			
耐高温		增强附着力	
厚度		厚度	
NR77-1000PY	0.7µm - 2.1µm	NR9-1000PY	0.7µm - 2.1µm
NR77-1500PY	1.1µm - 3.1µm	NR9-1500PY	1.1µm - 3.1µm
NR77-3000PY	2.1µm - 6.3µm	NR9-3000PY	2.1µm - 6.3µm
NR77-6000PY	5.0µm - 12.2µm	NR9-6000PY	5.0µm - 12.2µm
耐温性 = 180°C。		NR9-8000	6.0µm - 25.0µm
NR-PY 型负性抗蚀剂的曝光剂量很容易控制底切程度。在加工温度 < 120°C 时，NR1 和 NR7 系列抗蚀剂可在 25°C 下剥离。		耐温性 = 100°C。 NR9 系列抗蚀剂提供增强的附着力，并且在 25°C 时易于剥离。	



- 应用
 - 促进单层剥离工艺在没有 RIE 的情况下对金属和电介质进行图案化
 - 设备的永久组件 (即垫片等)
- 特性
 - 在抗蚀剂显影过程中形成抗蚀剂底切
 - 厚度范围: 0.7 - 25.0 µm
 - 根据曝光能量轻松调整抗蚀剂底切程度
 - 对小于 380nm 的波长的灵敏度
- 对生产力的影响
 - 消除对金属和电介质进行图案化的干法蚀刻工艺
 - 无需双层抗蚀剂

SU-8系列产品

SU-8 2000 Features

- 高纵横比成像
- 单涂层中0.5至>200µm膜厚度
- Improved coating properties
- 提高吞吐量更快地干燥
- Near UV (350-400 nm) processing
- Vertical sidewalls

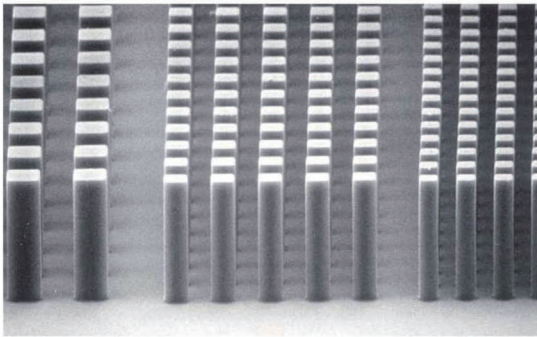
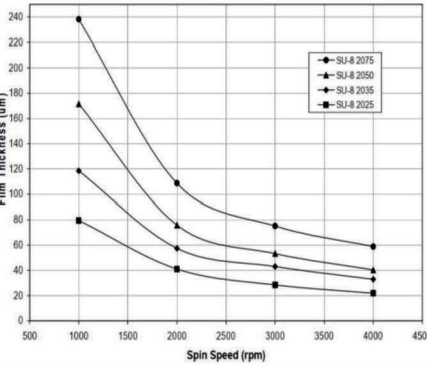


图1. SU-8 2000旋转速度与厚度



SU-8 2000	% Solids	Viscosity (cSt)	Density (g/ml)
2025	68.55	4500	1.219
2035	69.95	7000	1.227
2050	71.65	12900	1.233
2075	73.45	22000	1.236



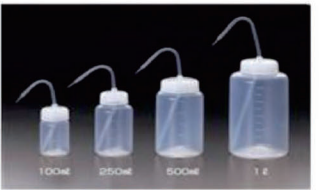
注射器过滤器（进口）



硅片镊子



手套



试剂瓶



头套



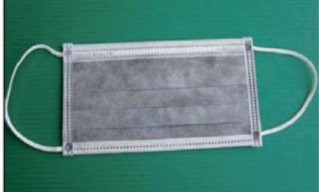
HDPE广口瓶/窄口瓶



无尘布/无尘纸



粘尘垫



口罩



氮气柜



划片刀



棉签



晶圆提篮



无尘服/无尘大褂



无尘鞋

单片盒

可提供2" ~12"，用于样品展示或小批量运输



25槽PP花篮

可提供2" ~8"，一般用在产线机台，作为传递盒使用。有何种颜色和黑色区分，黑色防静电



硅片运输盒

可提供2" ~12"，12寸叫FOSB；亚克力材质



不锈钢cassette

可提供2" ~12" 用于清洗和烘烤一体化



SIMF POD

可提供8"，属于特殊品料盒



特氟龙零配件

提供各种尺寸的特氟龙管子，接头，阀门；用于机台和厂务二次配，适合维修配备备件。



玻璃研钵+研磨棒



玻璃结晶皿

特氟龙清洗花篮&配套把手

可提供2" ~12"，用于酸碱槽清洗制程



六角盒

可提供6" ~12"，用于装铁环出货。配套铁环以及塑料环也可以提供



料盒shipping box

可提供2" ~8"；用于装Pasette的盒子，用来在产线里面传递使用



铝合金花篮

可提供6" ~12"，用于高温烘烤

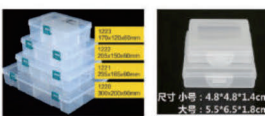


铝合金盒

用在产线，横向插入铁环



迷你盒

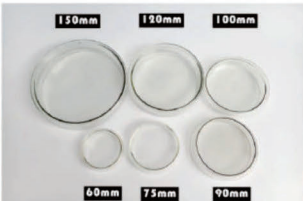
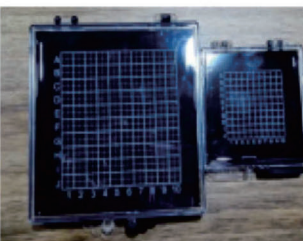


玻璃滴管



塑料试管架

吸附盒



玻璃培养皿